

第二届薄膜物理与应用国际会议 ('94TFPA)

由中国物理学会与上海物理学会共同主办的第二届薄膜物理与应用国际会议 ('94TFPA) 将于 1994 年 4 月 15 日至 17 日在上海金沙江大酒店举行. 本次学术会议的中心论题有以下三个方面:

- 1, 薄膜物理: 结构和理论、表面和界面、量子阱和超晶格;
- 2, 薄膜材料及性能测试: 半导体薄膜、铁电和压电膜、光学膜、光电膜、磁膜、超导膜、有机膜、合成膜及生物工程膜等;
- 3, 薄膜器件、工艺及应用: 薄膜生长和淀积工艺、薄膜元器件及其集成、微制作技术、各种应用等.

会议期间将举办薄膜器件、材料、制造设备、测试与分析仪器以及非贸易性的小型展览和广告.

应征稿件请寄: 上海市 800-211 信箱, 《光学学报》编辑部 (邮编: 201800), 李逸峰收 (请注明: '94TFPA 稿件), 来稿摘要截止期: 1993 年 12 月 1 日; 录用通知时间: 1994 年 2 月 1 日; 注册最后日期: 1994 年 3 月 5 日.

展览与广告事宜请与会议秘书处联系: 上海市南昌路 47 号上海物理学会汪朗焯收 (邮编: 200020).

欢迎来函索取 '94TFPA 会议外文通知, 可寄给您所熟悉的国外专家和朋友, 或来信告知他们的详细地址, 由会议秘书处代发.

第二届薄膜物理与应用国际会议秘书处
1993 年 8 月